

株式会社 **SCREEN** セミコンダクターソリューションズ

## 台湾・国立清華大学とのパートナーシップに合意 ～「固有ID」を持つセキュリティーICチップの 直接描画試作ライン設立をサポート～

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズはこのほど、12インチウエハーで大規模電子ビーム直接描画（MEBDW）リソグラフィーを行うプログラム（MEB12）の開始記念式典において、台湾の国立清華大学（以下、NTHU）をサポートする覚書に署名しました。

NTHUは、国際的な半導体製造装置メーカーおよびソフトウェア提供会社と共に、最先端のマスクレスリソグラフィー技術を開発するための、世界初となる革新的なMEBDW半導体の産学共同体を設立します。

MEBDWリソグラフィーは「オンチップセキュリティー」を実現するもので、インターネット、人工知能、電子決済、および自動車向けのICチップにセキュリティー情報を付加。この「固有ID」を持つセキュリティーチップの開発および試作を、世界で初めて台湾で行うことを可能にします。

MEB12への参加企業には、MEBDWリソグラフィー装置を世界で唯一製造するオランダ・Mapper Lithography社や、設計ソフトウェアを提供する米国・Synopsys社も含まれています。当社は、コーターデベロッパー「DT-3000」および枚葉式洗浄装置「SU-3200」により、MEB12をサポートします。

MEB12の発起人の一人である邱博文教授（NTHU・電機系／電子所 教授、ナノ技術材料科技中心 主任）は、「このプロジェクトは、半導体製造分野における台湾の強い影響力による成功例です。国際的な大手半導体企業と共同体を形成し、最先端の商業用12インチMEBDWリソグラフィープロセスラインを敷地内に建設することによって、NTHUは同分野において研究開発機能を持つ世界初の大学となります」と述べています。

また、当社の代表取締役 社長執行役員である須原忠浩は、「当社がMEB12の先駆けとなるNTHUをサポートすることができ、非常に光栄です。当社の装置技術とリソースの価値が、IoT応用分野の革新に役立つ証しとなるでしょう」と述べています。

MEB12には、台湾および近隣アジア諸国の半導体IC設計・製造企業がメンバーシップとして参加しており、革新的なICチップの共同開発が可能となっています。邱教授は、「セキュリティーチップの開発に加え、マスクレスIC設計の検証プラットフォームとしても利用できます。急騰するフォトマスクの大幅なコスト削減によって、新興のIC設計会社の負担を軽減したり、高い解像度と柔軟な描画性能によって、ニッチな市場向けの低コストファウンダリーを救済できます」と述べています。

### ■ 国立清華大学（NTHU）

国立清華大学は、1911年に北京で「清華学堂」として創立。1956年、現在の所在地である台湾・新竹市で復興（復校）された。移転後は、科学、技術、工学、人文社会、科技管理といった広範囲の学位工程を提供する総合研究大学へと発展。例年、東アジアにおける最高ランクの大学の一つとして名を連ねており、将来の指導者輩出校として広く知られている。詳しい情報は、<http://nthu-en.web.nthu.edu.tw/>を参照。

## ■ 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ

京都市に本社を置くSCREENセミコンダクターソリューションズは、長年培ったエッチングおよびフォトリソグラフィをコア技術として、1970年代に半導体製造装置市場に参入。洗浄装置分野においては、ますます重要度が高まる洗浄プロセスを背景に、確固たるシェアを築いている。顧客視点に基づくイノベーションを続け、高品質な製品やサービスを通じてユーザーの事業に貢献し続けることを基本方針としている。詳しい情報は、[www.screen.co.jp/spe](http://www.screen.co.jp/spe)を参照。

● 本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 社長オフィス 企画部 Tel: 075-417-2527 [speinfo@screen.co.jp](mailto:speinfo@screen.co.jp)